

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 7 月 27 日 (2006.7.27)

【公開番号】特開 2000-327617 (P2000-327617A)

【公開日】平成 12 年 11 月 28 日 (2000.11.28)

【出願番号】特願 平 11-327155

【国際特許分類】

C 0 7 C 41/42 (2006.01)

C 0 7 B 63/04 (2006.01)

C 0 7 C 41/46 (2006.01)

C 0 7 C 43/215 (2006.01)

C 0 7 C 67/54 (2006.01)

C 0 7 C 67/62 (2006.01)

C 0 7 C 69/157 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 41/42

C 0 7 B 63/04

C 0 7 C 41/46

C 0 7 C 43/215

C 0 7 C 67/54

C 0 7 C 67/62

C 0 7 C 69/157

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 6 月 14 日 (2006.6.14)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

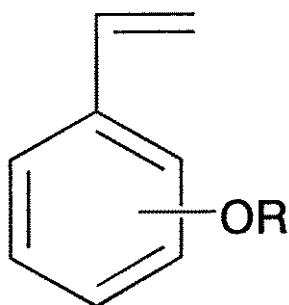
【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】下記一般式 (1) (式中、R は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基、アルコキシアルキル基、アルキルカルボニル基、アルコシカルボニル基又はアルキルシリル基を表す。) で表されるオキシスチレン誘導体の蒸留において、重合禁止剤としてニトロ化合物及び / 又はニトロ化合物を添加することを特徴とするオキシスチレン誘導体の蒸留方法。

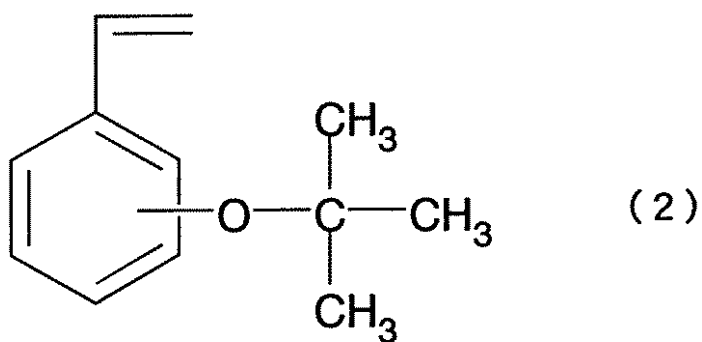
【化 1】



(1)

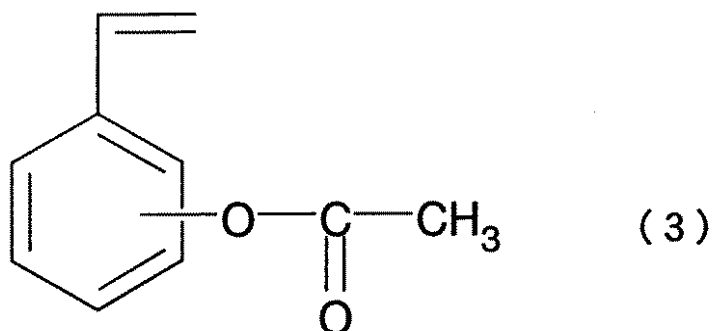
【請求項 2】オキシスチレン誘導体が、下記一般式 (2) で表される第三級 - ブトキシスチレンであることを特徴とする請求項 1 に記載の蒸留方法。

【化 2】



【請求項 3】オキシスチレン誘導体が、下記一般式 (3) で表されるアセトキシスチレンであることを特徴とする請求項 1 に記載の蒸留方法。

【化 3】



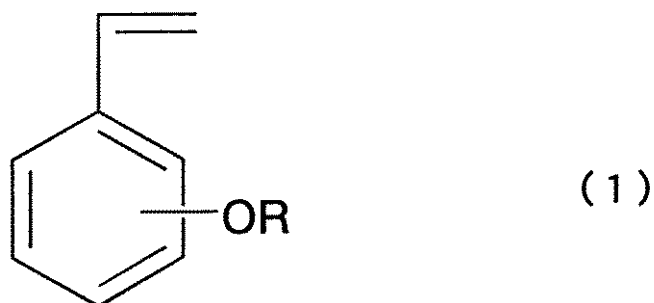
【請求項 4】ニトロソ化合物が、N - ニトロソフェニルヒドロキシルアミン及び / 又はその塩であることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の蒸留方法。

【請求項 5】ニトロ化合物が、ジニトロフェノールであることを特徴とする請求項 1 ~ 3 のいずれかに記載の蒸留方法。

【請求項 6】請求項 1 に記載のオキシスチレン誘導体の蒸留方法により得られる、下記一般式 (1) (式中、R は、アルキル基、アリール基、アリールアルキル基、アルコキシアルキル基、アルキルカルボニル基、アルコキシカルボニル基又はアルキルシリル基を表わす。)

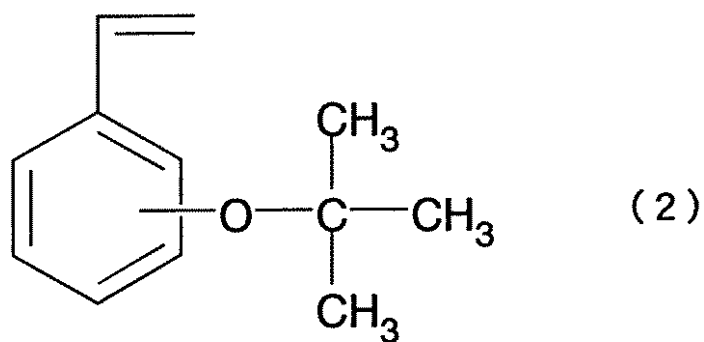
で表されるオキシスチレン誘導体。

【化 4】



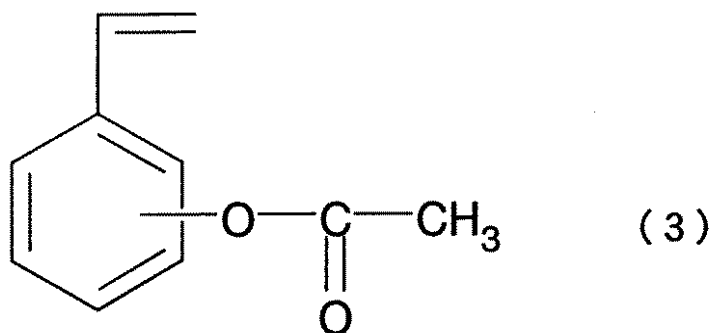
【請求項 7】オキシスチレン誘導体が、下記一般式 (2) で表される第三級 - ブトキシスチレンであることを特徴とする請求項 6 に記載のオキシスチレン誘導体。

【化 5】



【請求項 8】オキシスチレン誘導体が、下記一般式 (3) で表されるアセトキシスチレンであることを特徴とする請求項 6 に記載のオキシスチレン誘導体。

【化 6】



【請求項 9】ニトロソ化合物として N - ニトロソフェニルヒドロキシルアミン及び / 又はその塩を用いることを特徴とする請求項 6 に記載のオキシスチレン誘導体。

【請求項 10】ニトロ化合物としてジニトロフェノールを用いることを特徴とする請求項 6 に記載のオキシスチレン誘導体。